

# 生成AI時代の意匠実務：革新と法的課題、そして国際的な潮流

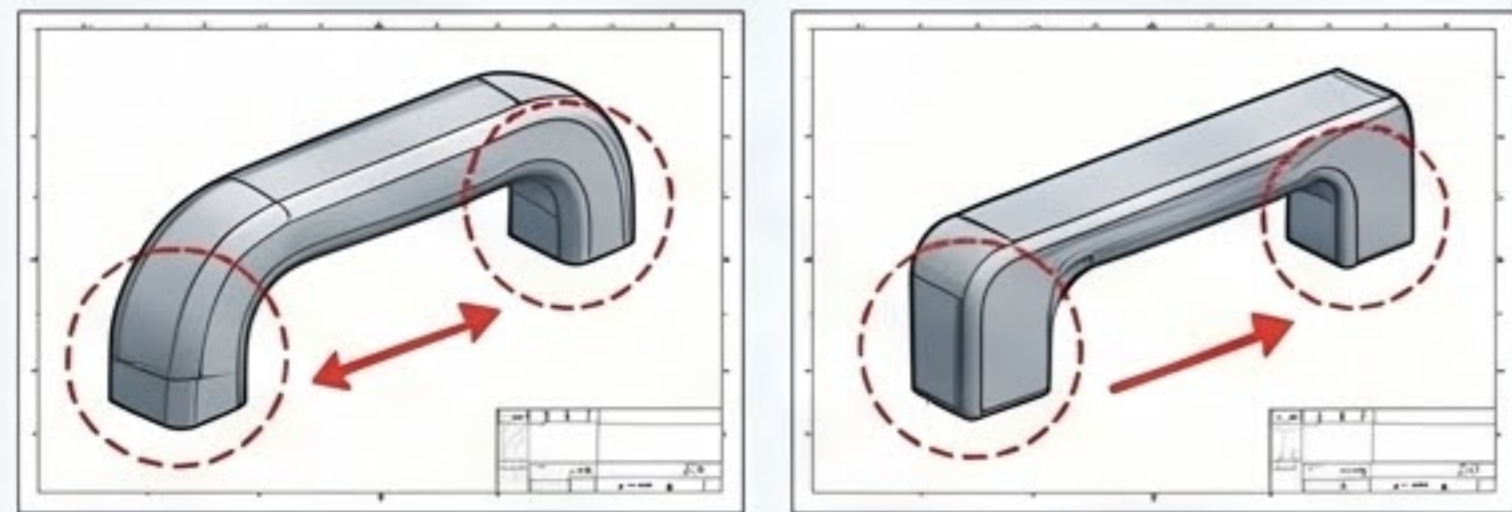
## 意匠創作・出願におけるAIの役割とプロセスの変化



### AIツールの精度とカスタム機能



### 画像生成AIが抱える「不整合 (Inconsistencies)」の壁



図面A (AI生成)      図面B (AI生成)

確率論的なAIは、異なる視点間で部品の配置や比率の差異を生じさせやすく、意匠拒絶の原因となる。

## 主要国特許庁における政策対応と実務要件の比較

米国 (USPTO)	日本 (JPO)	欧州 (EUIPO)
<p>自然人のみの発明者適格性を堅持</p> <p>2025年改訂ガイドライン：AIはツール。自然人が「着想」に重大な貢献をした場合のみ保護対象。</p> <p>2025年7月：AI画像検索ツール (Conception) 導入。</p>	<p>2026年の法改正で大量生成リスクに対応</p> <p>AIによる「先行意匠の大量生成」による新規性喪失に対抗。</p> <p>2026年意匠法・特許法改正を検討。</p> <p>画像検索精度を約70% (従来比2倍超) に向上。</p>	<p>エンフォースメントへのAI活用と透明性</p> <p>侵害検知にAI活用。AIの判断根拠を理解可能な「説明可能なAI (XAI)」導入を重視。</p> <p>機械学習ツール実用化。</p>

比較データ	米国	日本	欧州
発明者の要件	発明者は自然人に限定	発明者は正当な創作者を保護	発明者は学習データバイアス注視
最新動向	AI検索ツール導入	法改正検討と検索精度向上	侵害検知と機械学習実用化

## 知財実務家・企業のためのリスクマネジメント

☑ 類似意匠検索プラットフォームによる高度なクリアランス

Patentfield等のAI検索機能を活用し、言語の壁を越えて類似意匠を横断検索。侵害リスクを早期発見。

☑ 創作プロセスの証跡管理 (Evidence Management)

米国等への出願を見据え、プロンプト履歴や人間による修正過程を記録。「自然人による重大な貢献」を証明できる体制を構築。

☑ 人間による介入の必要性：AIモデルの再利用率

実務統計：AI生成モデルのうち修正なしでそのまま意匠図面として利用できるのは約10件に1件 (10%)。

